ALKALI DEVELOPABLE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP2002072469

Publication date: 2002-03-12

Inventor: YOSHIDA YUKIO; MIYAKE HIROTO
Applicant: DAICEL CHEM; DAICEL UCB CO LTD

Classification:

- international: G03F7/027; C08F299/06; C08G18/67; H05K3/00; G03F7/027; C08F299/00; C08G18/00; H05K3/00;

(IPC1-7); G03F7/027; C08F299/00; C08G18/00; H05K3/00;

H05K3/00

- european:

Application number: JP20000267892 20000905 Priority number(s): JP20000267892 20000905

Report a data error here

Abstract of JP2002072469

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition which achieves a tackfree state only by evaporating a solvent after application to a substrate and can retain satisfactory flexibility even after irradiation with energy beams such as UV. SOLUTION: The photosensitive resin composition comprises 100 pts.wt. urethane (meth)acrylate (D) obtained by reacting a carboxylcontaining lactone type polyester polyol (A) with a polyisocyanate (B) and hydroxyl-containing (meth) acrylates (C), 10-120 pts.wt. compound (E) obtained by adding a monomer having an alicyclic epoxy group and an ethylenically unsaturated group to part of the carboxyl groups of a (meth)acrylic acid-(meth)acrylic seter copolymer and an organic solvent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list 1 family member for: JP2002072469 Derived from 1 application. Back to JP2002072469

1 ALKALI DEVELOPABLE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION Publication info: JP2002072469 A - 2002-03-12

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-72469 (P2002-72469A)

(43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)

(51) Int.Cl.7	裁別配号	ΡI	ケーマコード(参考)			
G03F 7/027	513	C 0 3 F 7/027	513 2H025			
	5 1 5		515 41027			
C 0 8 F 299/06	C 0 8 F 299/06		4 J 0 3 4			
C 0 8 G 18/67		C 0 8 G 18/67				
H05K 3/00		H05K 3/00	H 0 5 K 3/00 F			
		審查請求 未請求	請求項の数3 OL (全 6 頁)			
(21)出顧番号	特顯2000-267892(P2000-267892)	(71) 出頭人 00000%	膜人 000002901			
		ダイセル化学工業株式会社				
(22) 山崎日	平成12年9月5日(2000.9.5)	大阪府堺市鉄砲町1番地 (71)出額人 592019589				
		ダイセ	ル・ユーシーピー株式会社			
		東京都	千代田区霞が関3 5目2番5号			
		(72)発明者 吉田	(72)発明者 吉田 幸夫			
		広島県:	大竹市玖波 6 - 8 - 4			
		(72)発明者 三宅	弘人			
		広島県:	大竹市玖波 6 - 8 - 2			
		(74)代理人 100090	491			
		弁理士	三浦 良和			
			最終質に続く			

(54) 【発明の名称】 アルカリ現像可能な感光性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 樹脂を基材に塗布した後、溶剤を蒸発させる だけで、タックフリー性を達成し、しかも、紫外線等の エネルギー線を照射した後でも十分な柔軟性を保持でき る感光性粉脂組成物を提供すること。

【解決手段】 カルボキシル基を含有するラクトン系ボ リエステルポリオール(A)、ボリイソシアネート

- (B)、水酸基を含有する (メタ) アクリレート類
- (C)を反応させて得られるウレタン (メタ) アクリレート(D) 100重量部と(メタ) アクリル酸ー(メ
- タ)アクリル酸エステル共重合体のカルボキシル基の一 部に脂環式エボキシ基とエチレン性不飽和基を有するモ ノマーを付加させた化合物(E)10~120重量部、

及び有機溶剤からなる感光性樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】カルボキシル基を含有するラクトン系ポリ エステルポリオール(A)、ポリイソシアネート

- (B)、水酸基を含有する(メタ)アクリレート類(C)を反応させて得られるウレタン(メタ)アクリレ
- ート(D)100重量部と(メタ)アクリル酸ー(メ タ)アクリル酸エステル共重合体のカルボキシル基の一
- タ)アクリル酸エスアル天里台杯のカルホキンル基の一部に脂環式エポキシ基とエチレン性不飽和基を有するモノマーを付加させた化合物(E)10~120重量部、及び有機溶剤からなるを光性樹脂組成物。

【請求項2】ウレタン (メタ) アクリレート (D) がカルボキシル基を含有するラクトン系ボリエステルポリオール (A)、ポリイソシアネート (B)、水敷基を含有する (メタ) アクリレート類 (C) をモル比で (1~1 0): (2~11): (2~3) の割合で反応させて得られることを特徴とする請求項1記数の患光性樹脂組成物。

【請求項3】ウレタン (メタ) アクリレート (D) 1 0 の重量部に対し化合物 (E) が40~100重量部添加 されてなる請求項1又は2に記載の感光性樹脂組成物。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野」な奈明は特定のウレタン(メ タ)アクリレートと(メタ)アクリル酸系共産合体誘導 体からなる感光性動脈組成物に関する。より詳しくは、 柴外線や電子線等の活性エネルギーにより、速やかに硬 化し、有用的はは、機節の未硬化部分をアルカリ水溶液で 現像し、パターンを形成させるようなプリント基板のレ ジスト材料や、PS版(Presensi tized plate)を始めと さな印刷版材料や原用分野である

[0002]

【従来の技術】アリント基板用・ジスト材料は従来、グ リシジル基を有するノボラックやビスフェノールタイプ のエボキン化合物に(メタ)アクリル酸を付加させたエ ボキシアクリレートや、(メタ)アクリル酸ー(メタ) アクリル酸エステル共連合体と(メタ)アクリレートモ ノマーの組成物などが用いられている。

【0003】しかしながら、近年家電製品の小型化、軽量化に伴い、基板の薄化、フィルム化が進んできており、後来のエポキシアクリレートや、アクリル・問題では、基板の曲げ、歪みに対応ができないという久良が生してきた。また、柔軟性のみを考慮すると、アクリレート系ではウレタンアクリレートを用いることが終ましいであるうことは、容易に野椎されることであるが、ウレタンアクリレートの分子量が小さいと、エネルギー線の照射前、即ち、海神段操後のタック(べとつき)がひどく、パターンのネガに樹脂が付着し、その船度未才の洗浄が必要であると同時に、付着が原因で、木がをはが等際に樹脂のパターンを尚ず可能性もある。一方ウレタン

アクリレートの分子量が大きいと粘度が高く、塗工性が 悪いばかりでなく、ウレタンアクリレート製造時に多量 の希釈溶媒を使用しなければならず、更には塗布、乾燥 時に多量の溶剤を蒸発させなければならないという欠点 がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、これ らの欠点を改良し、樹脂を基材に途乱した後、海和を蒸 発とせるだけて、タックフリー性を達成し、しかま 外線等のエネルギー線を照射した後でも十分な柔軟性を 保持できる感光性樹脂組成物を提供することである。 「0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは 上記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、カルボキシル基を含有 するラクトン系ポリエステルポリオール、ポリイソシア ネート、水酸基を含有する(メタ)アクリレート類を反 応させて得られるウレタン (メタ) アクリレートに (メ タ)アクリル酸-(メタ)アクリル酸エステル共重合体 のカルボキシル基の一部に3.4-エボキシシクロヘキ セニルメチル (メタ) アクリレートを付加させた化合物 を特定量配合することにより、得られる樹脂組成物が、 塗布、溶剤乾燥後にすでにタックフリー性が達成され... 活件エネルギー線による硬化後も柔軟件を有することを 見出し、本発明を完成させるに至った。即ち、本発明 は、カルボキシル基を含有するラクトン系ポリエステル ポリオール (A)、ポリイソシアネート (B)、水酸基 を含有する (メタ) アクリレート類 (C) を反応させて 得られるウレタン (メタ) アクリレート (D) 100重 量部と(メタ)アクリル酸-(メタ)アクリル酸エステ ル共重合体のカルボキシル基の一部に脂環式エポキシ基 とエチレン性不飽和基を有するモノマーを付加させた化 合物(E)10~120重量部、及び有機溶剤からなる 感光性樹脂組成物を提供する。前記発明においてウレタ ン (メタ) アクリレート (D) がカルボキシル基を含有 するラクトン系ポリエステルポリオール(A)、ポリイ ソシアネート(B)、水酸基を含有する(メタ)アクリ レート類(C)をモル比で(1~10):(2~1 1): (2~3)の割合で反応させて得られる感光性樹

1): (2~3)の割合で灰ゆさせて待られる窓光性樹 脂組成物を提供する。ウレタン(メタ)アクリレート (D)100重量部に対し化合物(E)を40~100 重量部添加してなる前記発明の宏光性樹脂組成物を提供 する。

【0006】木架岬の感光性簡単組成物を構成するカル ボキシル基を含有するラクトン系ポリエステルポリオー ル(A)(以下、「ポリオール(A)」と略称する。) は、触媒の存在下、ジヒドロキシカルボン酸を開始附足 レてラクトン類の料かに関い、開環的加速含せるととにより 合成できる。ラクトン類の付加量としては、ジヒドロキ シカルボン酸 1モルに対し1~50モル、更には2~3 クモルである。ラクトン類の付加量が、1モル未満で は 季軟件が不十分となって好ましくない。また、50 モルを超えると、耐汚染性が悪くなったり、アルカリ現 像性が悪化し好ましくない。ジヒドロキシカルボン酸と しては、例えば、2、2-ジメチロールブタン酸、2、 2-ジメチロールプロピオン酸、ジオキシアジピン酸等 が挙げられる。ラクトン類としては、 ε -カプロラクト ン、ァーブチロラクトン、δ-バレロラクトン等が挙げ られる。このうち ϵ -カプロラクトンが好ましく用いら れる。ポリオール (A) の数平均分子量は、250~ 6,000、好ましくは350~3,000である。ポ リオール (A)の数平均分子量が、250未満では、柔 軟性が不十分となり、好ましくない。また、6,000 を超えると、耐汚染性が悪くなったり、アルカリ現像性 が悪化し好ましくない。ジヒドロキシカルボン酸に付加 するラクトン類のモル数でポリオール (A)の数平均分 子量を調整することができる。

【0007】ポリオール(A)の合成時に開環付加重合に用いる触媒としては、例えば、テトラエチルチタネート、テトラブトルチタネートなどの有機テクン系化合物、オクチル酸スズ、ジブチルスズオキサイド、ジブチルスズジラウレートなどの有機スズ系化合物、塩化第一次ズ、臭化第一次ズなどのハロゲン系第一スズが挙げられる。これらの触媒は、仕込み原料に対して、0.1~1、000ppm、好ましくは1~800ppm用いる。反応速度は、70~240℃、好ましくは90~20℃である。

【0008】 本典明に用いられるポリイソシアネート (1000 に) 大き族系、 脂環動放棄ス (出版環かがリイシアネート (1下 D 1)、 トリレンジイソシアネート (1下 D 1)、 トリレンジイソシアネート (1下 D 1)、 トリレンジイソシアネート (1下 D 1)、 大力・エルメタンジイソシアネート (H 1 M D 1)、 木造ジフェニルメタンジイソシアネート (H 1 M D 1)、 大力・エルメタンがリイソシアネート (外 D 1)、 文性 シンジイソシアネート (N D 1)、 大陸 M D 1) キシリレンジイソシアネート (N D 1)、 へキカナンジイソシアネート (H M D 1)、 へキカナンジイソシアネート (H M D 1)、 へトカナンジイソシアネート (T M H D 1) などのポリイソシアネート がいけこれらのポリイソシアネート の三量体化合物など が挙げられる。

【0009】本発明における、水敷基を含有する(メ タ)アクリレート類(C)としては、2-ヒドロキシエ チル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシアロ・ (メタ)アクリレート、3-ヒドロキシブロビル(メ タ)アクリレート、4-ヒドロキシブチル(メタ)アク リレート;ジー6しくはトリーエンチングリコール又は プロピレングリコール(メタ)アクリレートのようなジ ーもしくはトリーアルキレングリコール(メタ)アクリ レート;グリセロールモノ(メタ)アクリレート、グリ セロールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロ パンジ(メタ)アクリレート、グリセロールメタクリレ ートアクリレート、ベンタエリスリトールトリ(メタ) アクリレートのような多値アルコールの多価もしくは裏 崔(メタ)アクリレート・カフラクトン変性を 合有(メタ)アクリレート一般のカプロラントン変性物を どが挙行られる。なお、未発明において、(メタ)アク リレートを取れる。

ートを意味する。
[0010] 新記ポリオール(A)、ポリイソシアネート(B)、木酸基を含有する(メタ)アクリレート類
(C) を仮応させてウレシ(メタ)アクリレート
(D)が得られる。成分(A)、(B)、(C)は、・
ル比で(1~10):(2~11):(2~3)、更に
は、(1~6):(2~7):(2~3)、更に
は、(1~6):(2~7):(2~3)の割合で反応
させることが好ましい。反応温度、3 0~1 5 0℃、更
には50~90℃が好ましい。得られるウレタン(メ
シ)アクリレート(D)の微酸は10~300mg KO

H/gの範囲にあることが好ましい。

【0011】ウルタン (メタ) アクリレート (D) に は、更に (メタ) アクリル酸一 (メタ) アクリル酸工 デル共連合体のカルボキシル基の一部に賠頭式エボキシ 基とエチレン性が設和基を有するモノマーを付加させる。 を配合する。 化合物 (E) の使用量は、ウレタン (メタ) アクリレート (D) 100重量部に関えして10~1 20重量部、更に440~100重量部が更ましい。 化合物 (E) の使用量が 20重量が 短ましい。 他高機成所の得られる原の柔軟性が失われ、途中觀に面曲試験で折り曲が自化、耐化の現象が実現し好ましくない。 配合量が10重要に高いているのである原の柔軟性が失われ、途中觀に面曲試験で折り曲が自化、耐化の現象が実現し好ましくない。 配合量が10重要に満たないとタックフリー性が 発現しかい。

【0012】タックフリー性を達成するために用いられる化合物(E)としては、例えばサイクロマーP(ダイセル化学工業(株)別のACAシリーズの各品番、ACA200、ACA200M、ACA210P、ACA250等が挙げられる。

【0013】また、感度、硬化性を調整さるために、必要に応じて本間婚組取物にアクリル及び/又はメタクリル基を有するモノマーを活加してもよい、モノマーの添加屋は、本樹脂組取物に対して、0.1~10重整然、更には0.5~5重量部が軽ましい、添加するアクリル及び/又はメタクリル基を有するモノマーとしては、1、4 一才タンジオールジ(メタ)アクリレート、1・6 ーへキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1・6 ーペキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1・9 イナンジオールジ(メタ)アクリレート、キリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリアロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリアロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコート

ールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコール ジ (メタ) アクリレート、ドリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ドリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メ タ) アクリレート、ペンタエリスリトールドトラ (メ タ) アクリレート、ベンタエリスリトールE O変性テ ラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールペキウ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールペキウ

【0014】光重合開始剤は化合物(E)を添加する時 に同時に加えるとよい。光重合開始剤は使用する光源の 波長において、分解、ラジカル発生するものであれば特 に限定されない。光重合開始剤としては、例えば、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-ヒドロ キシー2-メチルー1-フェニルプロパン-1-オン、 ジエトキシアセトフェノン、1-(4-イソプロピルフ ェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、1-(4-ドデシルフェニル)-2-ヒドロキシ -2-メチルプロパン-1-オン、4-(2-ヒドロキ シエトキシ) -フェニル (2-ヒドロキシ-2-プロピ ル)ケトン、2-メチル-1-「4-(メチルチオ)フ ェニル] - 2 - モルホリノプロバン - 1、ベンゾイン、 ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテ ル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインn-ブチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル、ベンジ ルジメチルケタール、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息 香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾ フェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、アクリル化ベン ゾフェノン、4-ベンゾイル-4 '-メチルジフェニル サルファイド、3,3'-ジメチル-4-メトキシベン ゾフェノン、チオキサンソン、2-クロルチオキサンソ ン 2-xチルチオキサンソン、2、4-ジメチルチオ キサンソン、イソプロピルチオキサンソン、2、4-ジ クロロチオキサンソン、2、4-ジエチルチオキサンソ ン、2、4-ジイソプロピルチオキサンソン、2、4、 6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフインオキサ イド、メチルフェニルグリオキシレート、ベンジル、カ ンファーキノンなどが挙げられる。添加量はウレタン (メタ) アクリレート(D) 100重量部に対して1. 0~10.0重量部が好ましい。

【0015】本発明で用いられる有機溶剤としては、一度的なエステル構、エーアル類、ケトン類を挙げることができる。沸成が反応温度より高からのであれば使用可能であるが、イソシアキートと反応するような官能基。例えば水酸蒸、カルボキシル基。アン基をとをさないものが作ましい。これらの解析は前記ウレクシン(メタ)アクリレート(D)に合物(E)を配合する時、成いは(D)と(E)の混合物に添加して本売別の必然

性樹脂組成物を構成し、塗布操作を容易にするために用いられる。 有機溶剤は固形分濃度が20~80重量%となる様に用いることが好ましい。

[0016] このようにして得られる本発明の悪性性制 語観度物には、必要に応じて充填剤、分散剤、その他の 添加剤を添加してもよい、また、患性性制能相談物はボ リ塩化ヒル (PVC)、ボリエチレンテレフタレート (PET)、ボリコビレン (PP)、ボリイミト等の ボリマーのフィルム基材に塗布し、溶剤を除去すると、 タックフリーの膜を得ることができる。 限算は、用途に より変えることができるが端布1、0~200ル配程度 である。この限は活性エネルギー線により現化老せて は、柔軟性を有しており、未硬化の部分エルカリ水溶 液で現像し、パターンを形成できるので、ブリント基板 のレジスト材料や、PS板を始めとする印刷板材料等に 用いることができる。

[0017]

【実施例】以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明を 更に具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例に 限定されるものではない、なお、実施例及び比較例中の %、部数値は、全て重量基準を意味する。また、評価方 法は以下のように行った。

(溶病乾燥後のタックフリー性):厚さ0.25mmの アルミ版上に乾燥後の厚さが約30μmとなるように整 光性樹脂組成物の溶液を途布し、80℃の熱風乾燥機中 で30分間乾燥させる。その後、室温まで戻し、指触で タック性を聞べた。

(感度) 前記タックフリー性を試験したのと同様のアル ミ板上に塗布された樹脂の上に21段のステップタブレ ットを載せ、80W/cmの高圧水銀ランプで、駅間 能10cm、進行方向の照射幅10cm、コンペアース ビード5m/分で紫外線を照けさせた。紫外線照射後、

- 1%の Na_2 C O_3 水溶液を15秒間スプレーし、現像、 水洗した。現像されたステップ段数により感度を確認した。表中の記号は以下のことを意味する。
- ○:指触でベタ付きを全く感じない。
- ○:指触でベタ付きを殆ど感じない。
- : 指触でベタ付きを感じる。

(柔軟性) 前記タックフリー性を試験したと同様のアル 家板上に塗布された樹脂を150℃のオープンで30分 間、後硬化を行った。その核、窓温まで戻し、塗飾形成 されてアルミ板をティーの高径が2mmの居曲試験機に かけ、折り目の白化、割れ状況を目積で観察した。表中 の記号は以下のことを意味する。

- :折り目の白化、割れが認められない。
- 【0018】次に本発明の実施例において用いたウレタン (メタ) アクリレート (D) の合成例について記載する

(合成例1 (D1)の製造)カルボキシル基含有ポリエ ステルポリオール成分(A)として、ラクトン系ポリエ

ステルポリオール (ダイセル化学工業(株)製、PCL205 BA、数平均分子量500、酸価112mgKOH/ g) ポリイソシアネート(B)としてTDI(トリレ ンジイソシアネート)、(メタ)アクリレート類(C) として、ヒドロキシエチルアクリレートをそれぞれ、モ ル比5:6:2(重量2500g:1044g:232 g)とり、製品総重量の30%となる量(1618g) のMMPGAC (ダイセル化学工業 (株) 製、プロピレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート) 中70°C で反応させ、カルボキシル基含有ウレタン (メタ) アク リレート(D1)を合成した。反応終了間際、残存NC O濃度が0.5%程度のところで、DBTDL(ジラウ リン酸ジブチルスズ)を全重量の100ppm相当量 (O. 54g)添加し、反応を促進させ、NCO濃度 0.14%で加熱、攪拌を停止した。

【0019】(合成例2(D2)の製造)合成例1にお けるヒドロキシエチルアクリレートをアクリル基含有ラ クトン系ポリエステルポリオール (ダイセル化学工業 (株)製、FA2D)に変えた他は合成例1と同じ条件 で、カルボキシル基含有ウレタンアクリレート(D2) を合成した。以下、本発明の実施例について説明する が、これらによって、本発明が限定されるものではな

【0020】(実施例1)合成例1で合成されたMMP GAC含有ウレタンアクリレート(D1)70部に、化 合物(E)としてサイクロマーP(ACA250)(ダ イセル化学工業(株)製、固形分48重量%、ジプロピ レングリコールモノメチルエーテル溶媒、 固形分酸価: 75KOHmg/g、二重結合当量380、樹脂Tg: 136℃、スチレン換算Mw:約10,000)(E

 を30部、及び光軍合開始剤として、イルガキュア 907 (日本チバガイギー(株)製)を4部加え、撹拌 混合し、溶液状の感光性樹脂組成物を得た。この溶液状 の感光性樹脂組成物について、タックフリー性、感度及 び柔軟性を前記の評価法により評価し、表1に示した。 【0021】(実施例2)ACA250(E1)の代わ りにサイクロマーP(ACA200)(ダイセル化学工 業(株)製、固形分48重量%、ジプロビレングリコー ルモノメチルエーテル溶媒、固形分酸価:115KOH mg/g、二重結合当量450、樹脂Tg:137℃、 スチレン換算Mw:約16,500)(E2)を用いた こと以外は実施例1と同様に行い、実施例1と同じ条件 で評価を行った。

【0022】(実験例3)合成例1のウレタンアクリレ ート(D1)の代わりに合成例2のウレタンアクリレー ト(D2)を用いた以外は実練例1と同様に行い、実練 例1と同じ条件で評価を行った。

【0023】(比較例1)合成例1のウレタンアクリレ ート(D1)100部に光重合開始剤として、イルガキ ュア907を4部加えたこと以外は、実施例1と同様に 行い、実施例1と同じ条件で評価を行った。

【0024】(比較例2)合成例1のウレタンアクリレ ート(D1)を30部、化合物(E)としてサイクロマ -P(ACA250)(E1)を70部に光重合開始剤 として、イルガキュア907を4部加えたこと以外は、 実施例1と同様に行い、実施例1と同じ条件で評価を行 った、実施例及び比較例の結果を表1に示した。 [0025]

【表1】

		実施例1	実施例?	実施例3	比較例1	比較例2
配	ウレタンアクリレート (D 1)	7 0	7 0		100	3.0
	ウレタンアクリレート (D 2)			7 0		
組	(E1)	3 0		3 0		7 0
成	(E2)		3 0			
性	溶剤乾燥後の タックフリー性	0	0	0	×	0
能	感度(ステップ段数)	7	8	8	6	6
	柔軟性 (屈曲テスト)	0	0	0	0	割れ

[0026]

【発明の効果】本発明のアルカリ現像可能な感光性樹脂 組成物は、溶剤乾燥後にタックフリー性が達成され、バ ターンネガを傷めないだけではなく、エネルギー線によ る硬化後も十分な柔軟性が保たれるため、フレキシブル な基材への印刷、パターンニング用インキ、塗料として 極めて有用である。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AB01 AB15 AC01 AD01 BC66

BC74 FA17

4J027 AA01 AA02 AG03 AG23 AG24

AG27 AG33 CD10

4J034 DF11 DF12 FA02 FB01 FC01

HA01 HA07 HC12 HC17 HC22

HC46 HC52 HC61 HC64 HC67

HC71 HC73 QA03